



KINTEK SOLUTION

Pacvd Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de **Preparação da amostra**, **Equipamento térmico**, **Consumíveis e materiais de laboratório**, **Equipamento bioquímico**, etc.

KINTEK SOLUTION

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Kintek Solution Ltd é uma organização orientada para a tecnologia, os membros da equipa dedicam-se a sondar a tecnologia mais eficiente e fiável e inovações no equipamento de investigação científica, campos como a reação bioquímica, investigação de novos materiais, tratamento térmico, criação de vácuo, refrigeração, bem como equipamento farmacêutico e de extração de petróleo.

Nos últimos 20 anos, ganhámos experiências ricas neste campo de equipamento de investigação, somos capazes de fornecer tanto o equipamento como a solução de acordo com as necessidades e realidades do cliente, também desenvolvemos muitos equipamentos à medida do cliente de acordo com um objetivo de trabalho específico, e temos muitos projectos bem sucedidos em muitas universidades e institutos de diferentes países, como Ásia, Europa, América do Norte e do Sul, Austrália e Nova Zelândia, Médio Oriente e África.

Profissão, resposta rápida, trabalho árduo e sinceridade são um rótulo notável da atitude de trabalho da nossa equipa, o que nos dá uma boa reputação entre os nossos clientes.

Estamos aqui e prontos para servir os nossos clientes de diferentes países e regiões, e partilhar a tecnologia mais eficiente e fiável!



Forno Tubular Slide Pecvd Com Gasificador Líquido Máquina Pecvd

Número do item: KT-PE12



introdução

Sistema PECVD de deslizamento KT-PE12: Ampla gama de potência, controlo de temperatura programável, aquecimento/arrefecimento rápido com sistema deslizante, controlo de fluxo de massa MFC e bomba de vácuo.

[Saiba mais](#)

Modelo do forno	KT-PE12-60
Temperatura máxima	1200°C
Temperatura de trabalho constante	1100°C
Material do tubo do forno	Quartzo de alta pureza
Diâmetro do tubo do forno	60mm
Comprimento da zona de aquecimento	1x450mm
Material da câmara	Fibra de alumina do Japão
Elemento de aquecimento	Bobina de fio Cr2Al2Mo2
Taxa de aquecimento	0-20°C/min
Par térmico	Construído em tipo K
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/controlador PID com ecrã tátil
Precisão do controlo de temperatura	±1°C
Distância de deslizamento	600mm
Unidade de plasma RF	
Potência de saída	5 -500W ajustável com estabilidade de ± 1%
Frequência de RF	13,56 MHz ±0,005% de estabilidade
Potência de reflexão	350W máx.
Emparelhamento	Automático
Ruído	
Arrefecimento	Arrefecimento a ar.
Unidade de controlo de precisão do gás	
Medidor de caudal	Medidor de caudal mássico MFC
Canais de gás	4 canais
Caudal	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2

Linearidade	±0,5% F.S.
Repetibilidade	±0,2% F.S.
Tubagem e válvula	Aço inoxidável
Pressão máxima de funcionamento	0,45MPa
Controlador do caudalímetro	Controlador de botão digital/controlador de ecrã tátil
Unidade de vácuo standard (opcional)	
Bomba de vácuo	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
Caudal da bomba	4L/S
Porta de aspiração de vácuo	KF25
Medidor de vácuo	Vacuómetro de silicone Pirani/Resistance
Pressão de vácuo nominal	10Pa
Unidade de alto vácuo (opcional)	
Bomba de vácuo	Bomba de palhetas rotativas+Bomba molecular
Caudal da bomba	4L/S+110L/S
Porta de aspiração de vácuo	KF25
Medidor de vácuo	Medidor de vácuo composto
Pressão de vácuo nominal	6x10-5Pa

As especificações e configurações acima podem ser personalizadas

Não.	Descrição	Quantidade
1	Forno	1
2	Tubo de quartzo	1
3	Flange de vácuo	2
4	Bloco térmico do tubo	2
5	Gancho do bloco térmico do tubo	1
6	Luva resistente ao calor	1
7	Fonte de plasma RF	1
8	Controlo preciso do gás	1
9	Unidade de vácuo	1
10	Manual de instruções	1

Máquina De Forno Tubular Rotativo Inclinado Para Deposição Química Melhorada Por Plasma (Pecvd)

Número do item: KT-PE16



introdução

Apresentamos o nosso forno PECVD rotativo inclinado para deposição precisa de película fina. Desfrute de uma fonte de correspondência automática, controlo de temperatura programável PID e controlo de caudalímetro de massa MFC de alta precisão. Características de segurança incorporadas para maior tranquilidade.

[Saiba mais](#)

Modelo do forno	PE-1600-60
Temperatura máxima	1600°C
Temperatura de trabalho constante	1550°C
Material do tubo do forno	Tubo de Al ₂ O ₃ de alta pureza
Diâmetro do tubo do forno	60mm
Comprimento da zona de aquecimento	2x300mm
Material da câmara	Fibra de alumina do Japão
Elemento de aquecimento	Disilicida de molibdénio
Taxa de aquecimento	0-10°C/min
Par térmico	Tipo B
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/controlador PID com ecrã tátil
Precisão do controlo de temperatura	±1°C
Unidade de plasma RF	
Potência de saída	5 -500W ajustável com estabilidade de ± 1%
Frequência de RF	13,56 MHz ±0,005% de estabilidade
Potência de reflexão	350W máx.
Emparelhamento	Automático
Ruído	
Arrefecimento	Arrefecimento a ar.
Unidade de controlo de precisão do gás	
Medidor de caudal	Medidor de caudal mássico MFC
Canais de gás	4 canais
Caudal	MFC1: 0-5SCCM O ₂ MFC2: 0-20SCCMCH ₄ MFC3: 0- 100SCCM H ₂ MFC4: 0-500 SCCM N ₂

Linearidade	±0,5% F.S.
Repetibilidade	±0,2% F.S.
Tubagem e válvula	Aço inoxidável
Pressão máxima de funcionamento	0,45MPa
Controlador do caudalímetro	Controlador de botão digital/controlador de ecrã tátil
Unidade de vácuo standard (opcional)	
Bomba de vácuo	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
Caudal da bomba	4L/S
Porta de aspiração de vácuo	KF25
Medidor de vácuo	Vacuómetro de silicone Pirani/Resistance
Pressão de vácuo nominal	10Pa
Unidade de alto vácuo (opcional)	
Bomba de vácuo	Bomba de palhetas rotativas+Bomba molecular
Caudal da bomba	4L/S+110L/S
Porta de aspiração de vácuo	KF25
Medidor de vácuo	Medidor de vácuo composto
Pressão de vácuo nominal	6x10-5Pa
As especificações e configurações acima podem ser personalizadas	

Não.	Descrição	Quantidade
1	Forno	1
2	Tubo de quartzo	1
3	Flange de vácuo	2
4	Bloco térmico do tubo	2
5	Gancho do bloco térmico do tubo	1
6	Luva resistente ao calor	1
7	Fonte de plasma RF	1
8	Controlo preciso do gás	1
9	Unidade de vácuo	1
10	Manual de instruções	1

Máquina De Revestimento Pecvd De Deposição Por Evaporação Reforçada Por Plasma

Número do item: KT-PED



introdução

Atualize o seu processo de revestimento com equipamento de revestimento PECVD. Ideal para LED, semicondutores de potência, MEMS e muito mais. Deposita películas sólidas de alta qualidade a baixas temperaturas.

[Saiba mais](#)

Suporte de amostras	Tamanho	1-6 polegadas
	Velocidade de rotação	0-20rpm ajustável
	Temperatura de aquecimento	≤800°C
	Precisão de controlo	±0.5°C Controlador PID SHIMADEN
Purga de gás	Medidor de fluxo	CONTROLADOR DE CAUDALÍMETRO DE MASSA (MFC)
	Canais	4 canais
	Método de arrefecimento	Arrefecimento por circulação de água
Câmara de vácuo	Tamanho da câmara	Φ500mm X 550mm
	Porta de observação	Porta de visualização total com deflector
	Material da câmara	Aço inoxidável 316
	Tipo de porta	Porta de abertura frontal
	Material da tampa	Aço inoxidável 304
	Porta da bomba de vácuo	Flange CF200
	Orifício de entrada de gás	Conector φ6 VCR
Potência do plasma	Fonte de energia	Potência DC ou potência RF
	Modo de acoplamento	Acoplado indutivamente ou capacitivo de placa
	Potência de saída	500W-1000W
	Potência de polarização	500v
Bomba de vácuo	Pré-bomba	Bomba de vácuo de palhetas 15L/S
	Porto da bomba turbo	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Porta de alívio	KF25
	Velocidade da bomba	Bomba de palhetas:15L/s[Bomba turbo:1200l/soHan_6216←1600l/s
	Grau de vácuo	≤5×10-5Pa
	Sensor de vácuo	Medidor de vácuo de ionização / resistência / medidor de filme
Sistema de vácuo	Fonte de alimentação eléctrica	AC 220V /380 50Hz

Potência nominal	5kW
Dimensões	900mm X 820mm X870mm
Peso da máquina	200kg



Kintek Solution

Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

